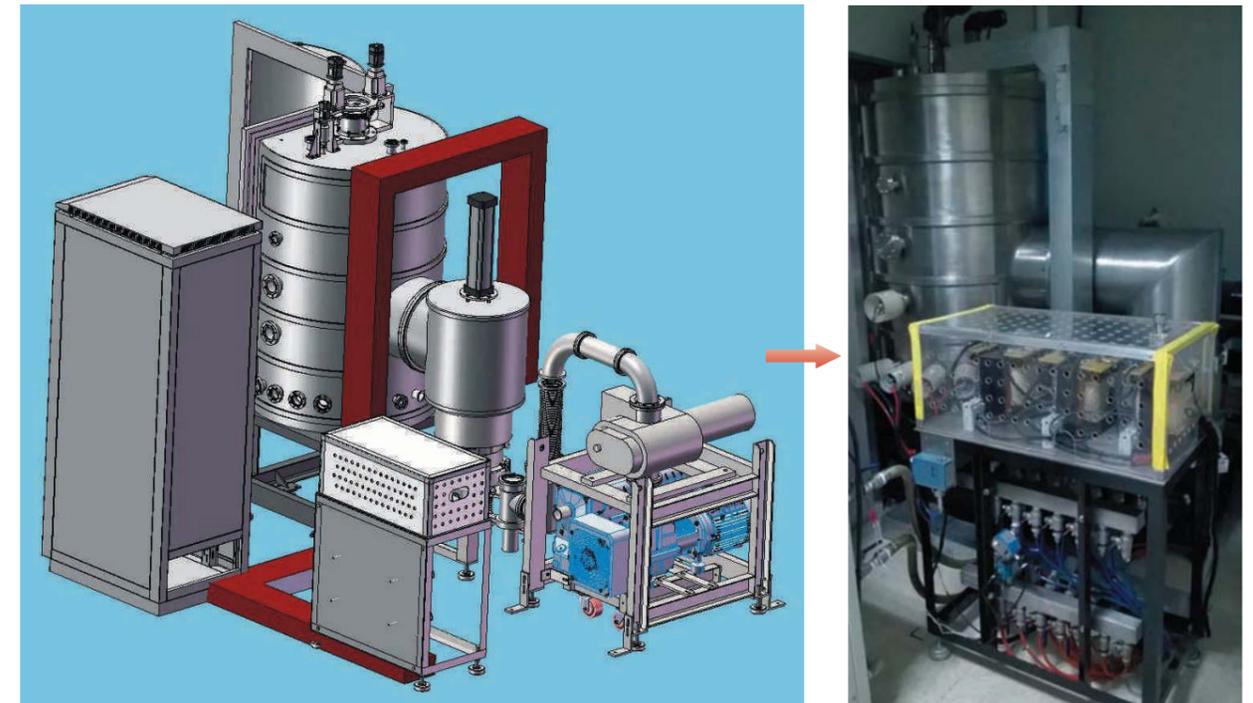


Технические характеристики

Описание	FCEV1213
Высота камеры (мм)	1300
Диаметр камеры (мм)	Ø1200
Дверь вакуумной камеры	2
Монтажный фланец распылительных катодов	6
Монтажный фланец ионного источника	1
спутники	24 x Ф120 мм
Мощность (кВт)	2 x DC15 + 1 x смещение 30
Максимум. Эффективная высота покрытия (мм)	850
Молекулярный насос с магнитной подвеской	2 x 2200 л / с
Корневой насос	1 x 1000 м ³ /ч
Роторно-лопастной насос	1 x 300м ³ /ч
Удерживающий насос	1 x 60м ³ /ч
Размеры подложек (мм)	420 x 120
	450 x 250
	440 x 140
	297 x 210
Вместимость	40 ~ 80 зависит от
Площадь установки (Д x Ш x В) мм	3000 * 4000 * 3200

Cesium Iodide (CsI) Vacuum Metallizing Equipment Оборудование для металлизации йодидом цезия (CsI)



If you are using PVD coating in your business, but need a more efficient solution, Royal Technology is able to upgrade your current production process!

Если вы уже используете PVD покрытие в своем бизнесе, но вам необходимо более эффективное решение, компания Royal Technology готова обновить ваш текущий процесс производства!

Royal Technology Cares About Your Health.

Компания Royal Technology заботится о вашем здоровье.

Royal Technology Csl-950

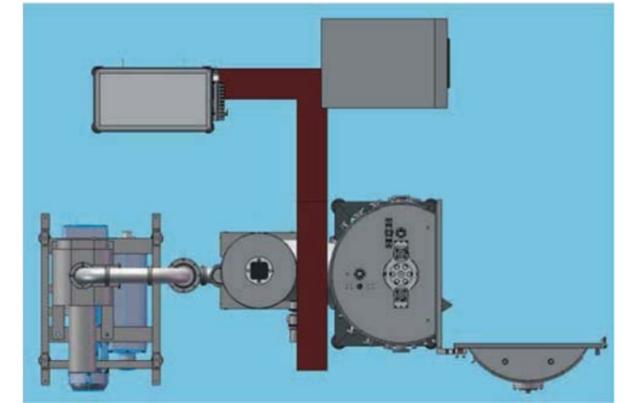
X-Ray Scintillator(Csl) High Vacuum Deposition System

Royal Technology Csl-950

Высоковакуумная система осаждения рентгеновского сцинтиллятора (Csl)



Ultra- High Spatial Resolution of X-Ray Imaging Application
Рентгеновское изображение со сверхвысоким пространственным разрешением



Efficiency

- Csl-950A+ model is with 2-rotary rack structure based on Generation -one Csl-950 model.
- Double-capacity for max. size substrate: 500 x400mm.

Repeatability & Reproducibility

- Through high precise parameter control system
- Automated process control software and program
- User friendly operation

Reliability

- 24/7 days non-stop operation;
- Inficon Film Thickness Controller to monitor the film thickness inline
- Temperature control accuracy: ± 1 °C, multi-stage setting, automatic temperature data recording and control
- Rotary racks equipped with Servo-Motor for high accuracy and stability

Safety

- High vacuum pump: Magnetic suspension molecular pump, with nitrogen gas blowing device to avoid hazardous material to be exposed in the air
- All electrodes are equipped with safety protection sleeves

Эффективность

- Модель Csl-950A+ имеет 2x-поворотную конструкцию стойки на основе модели Csl-950 первого поколения
- Двойная емкость для подложки максимального размера: 500 x 400 мм

Повторяемость и воспроизводимость

- Благодаря высокоточной системе управления параметрами
- Программное обеспечение и программа для автоматического управления процессом
- Удобная для пользователя эксплуатация

Надежность

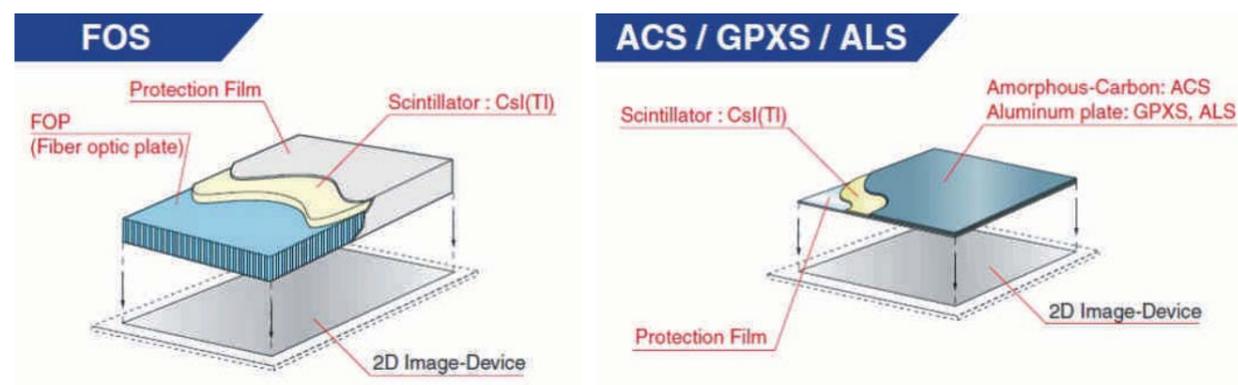
- Круглосуточная работа 24/7
- Контроллер толщины пленки Inficon для мониторинга толщины пленки
- Точность контроля температуры: ± 1 °C, многоступенчатая настройка, автоматическая запись и контроль температурных данных
- Поворотные стойки оснащены серводвигателем для высокой точности и устойчивости

Безопасность

- Высоковакуумный насос: Молекулярный насос с магнитной подвеской, и устройством продувки газообразным азотом для избежания попадания опасных веществ в воздух
- Все электроды оснащены защитными рукавами

Technical Specifications

Технические характеристики



CsI High Vacuum Deposition System is exclusively designed for CsI metallization on scintillation screens in an extremely high vacuum environment. The CsI scintillators 200~600µm in thickness ranges with high uniformity of thickness and brightness performance.

Cesium Iodide (CsI) deposition characteristics

- Ultra-high spatial resolution of imaging
- Fast response for sharp imaging
- Class leading edge-to-edge image areas
- Optical absorb or reflector layers
- Low patient X-ray dose

Application

For security check and inspection, high energy physics education, nuclear radiation detection and medical imaging: chest examination, mammography, dental inter/oral and panoramic.

Substrates Applied

TFT glass, fiber optic plate, amorphous-carbon plate, aluminum plate

Carbon layer protection film can be considered as post-deposition to improve to highest resolution

Высоковакуумная система осаждения CsI предназначена исключительно для металлизации соединения CsI на сцинтилляционных экранах в условиях чрезвычайно высокого вакуума. Сцинтилляторы CsI толщиной 200 × 600 мкм имеют высокую однородность толщины и яркость.

Характеристики осаждения йодида цезия (CsI)

- Сверхвысокое пространственное разрешение изображения
- Быстрый отклик для более четкого изображения
- Класс ведущих областей изображения от края до края
- Оптически поглощающие слои или отражающие слои
- Низкая доза облучения пациента

Применение

Для безопасного осмотра и проверки, образования в области физики высоких энергий, обнаружения ядерных излучений и медицинских изображений: обследование грудной клетки, маммография, стоматологические внутри-ротовые и панорамные обследования.

Применяемые подложки

TFT-стекло, волоконно-оптическая пластина, аморфно-углеродная пластина, алюминиевая пластина

Защитная пленка углеродного слоя может рассматриваться как последующее осаждение для улучшения высокого разрешения.

Description	CsI-950	CsI-950A+
Deposition chamber (mm)	φ950 x H1350	φ950 x H1350
Loading rotary racks	1	2
Evaporation sources	2	2
Heating method	Iodine tungsten lamp Max. 800°C	Iodine tungsten lamp Max. 800°C
Ultimated vacuum pressure (Pa)	8.0×10 ⁵ Pa	8.0×10 ⁵ Pa
Magnetic Suspension Molecular Pump	1 x 3400L/S	1 x 3400L/S
Roots Pump	1 x 490m ³ /h	1 x 490m ³ /h
Rotary Vane Pump	1 x 300m ³ /h	1 x 300m ³ /h
Deposition Controller	Quartz Control x 1	Quartz Control x 1
Power Consumption (KW)	Max.approx.62 Average approx.32	Max.approx.65 Average approx.35

Осаждение	CsI-950	CsI-950A+
Камера осаждения (мм)	Ø 950 x B1350	Ø 950 x B1350
Загрузочные поворотные стойки	1	2
Источник испарения	2	2
Способ нагрева	Йодная вольфрамовая лампа макс. 800 °C	Йодная вольфрамовая лампа макс. 800 °C
Предельное вакуумное давление (Па)	8.0×10 ⁵ Па	8.0×10 ⁵ Па
Молекулярный насос с магнитной подвеской	1 x 3400л/с	1 x 3400л/с
Корневой насос	1 x 490м ³ /час	1 x 490м ³ /час
Роторно-лопастной насос	1 x 300м ³ /час	1 x 300м ³ /час
Контроллер осаждения	Кварцевый x 1	Кварцевый x 1
Потребляемая мощность (кВт)	Макс. ≈ 62 Средний ≈ 32	Макс. ≈ 65 Средний ≈ 35